氙灯抽运液冷叠片式重复频率钕玻璃放大器研制

王冰艳1, 李养帅1*, 张攀政1**, 王利1, 刘强1, 朱海东1, 郭爱林1, 张艳丽1,

张旭¹,周琼¹,周申蕾¹,朱俭²,马伟新²,朱宝强¹,朱健强¹

1中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室,上海 201800;

²中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所,上海 201800

摘要 重复频率激光放大器是实现重复频率激光器的关键器件,其重复频率取决于对抽运及放大过程中产生热量的有效控制。针对千焦耳量级输出重复频率激光器的需求,通过合理的结构设计、冷却液选型及测试等,研制出一台基于氙灯抽运、钕玻璃增益介质、液体冷却、通光直径为 Φ 130 mm的激光放大器样机。测试结果表明,该放大器样机可实现每分钟一次的重复频率运行,同时具备双程 1.3189 倍净增益,双程动态波前 PV(peak to valley)平均值为 0.2718 波长(λ)(20 \mathbb{C} , λ =1053 nm,10 发次计)和 0.3223 λ (30 \mathbb{C} , λ =1053 nm,10 发次计)。

关键词 激光器; 重复频率激光放大器; 液体冷却; 氙灯抽运; 钕玻璃 中图分类号 O436 文献标识码 A

doi: 10.3788/CJL201946.1001007

Nd: Glass Amplifier with Repetition Rate Fabricated by Flash-Lamp Pumping and Liquid Cooling Method

Wang Bingyan¹, Li Yangshuai^{1*}, Zhang Panzheng^{1**}, Wang Li¹, Liu Qiang¹,

Zhu Haidong¹, Guo Ailin², Zhang Yanli¹, Zhang Xu¹, Zhou Qiong¹, Zhou Shenlei¹, Zhu Jian², Ma Weixin², Zhu Baoqiang¹, Zhu Jianqiang¹

¹National Laboratory on High Power Lasers and Physics, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China;

²Shanghai Institute of Laser Plasma, China Academy of Engineering and Physics, Shanghai 201800, China

Abstract A repetition rate laser amplifier is the key component of a repetition rate laser; here, the repetition rate of the amplifier is determined by precisely controlling the heat produced during pumping and amplifying. To achieve a repetition rate laser exhibiting kilojoule output energy, a repetition rate laser amplifier prototype with a diameter of 130 mm is developed based on flash-lamp pumping, a neodymium glass gain medium, and liquid cooling. After ensuring the rational mechanical design and selecting a coolant with suitable properties, the developed amplifier prototype operates at 1 shot per minute and exhibits a double pass small signal gain of 1.3189. At 1053 nm, the PV (peak to valley) of 10-shot average double pass wavefronts for the amplifier prototype are 0.2718 λ and 0.3223 λ when the temperatures of coolant are 20 °C and 30 °C, respectively.

Key words lasers; laser amplifier with repetition rate; liquid cooling; flash-lamp pumping; neodymium glass OCIS codes 140.3280; 140.3295; 140.3320

1引言

为实现激光惯性约束聚变(ICF),发展了一批 高功率激光装置,如国家点火装置(NIF)^[1],兆焦耳 激光装置(LMJ)^[2],神光(SG)装置^[3-4]等,由于大口 径片状放大器热效应的影响,这类装置的发次间隔 时间通常大于2h,不能满足未来聚变电站的需求。 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)提出了LIFE 计划^[5],阐述了激光惯性聚变-裂变能源设想,指出 适用于惯性聚变能(IFE)的激光驱动器需要满足 5~16 Hz 重复频率运行条件,并研制了一路原型机 Mercury 装置,该装置中激光放大器以Yb:SFAP

收稿日期: 2019-03-28; 修回日期: 2019-04-30; 录用日期: 2019-05-13

^{*} E-mail: yshli@siom.ac.cn; ** E-mail: nwpuzhangpanzheng@163.com

为增益介质,采用二极管抽运、高速氦气冷却、多程 放大技术路线,实现了 55 J/10 Hz 输出,由于大尺 寸激光晶体生长困难,该装置后期主要作为啁啾脉 冲放大(CPA)系统的抽运源^[6]。随后,重复频率激 光放大器获得了迅速的发展,发展了如 Dipole^[7], HiLase^[8],ELI-Beamlines L2、L3 激光装置^[9], SIOM 叠片式气冷放大器^[10-11]等使用的高速氦气冷 却技术路线,以及 Lucia^[12],SIOM 蓝宝石传导冷却 放大器^[13]等使用的热沉传导冷却技术路线。此类 重复频率激光放大器通常采用二极管抽运,以镱粒 子掺杂晶体/陶瓷或钕玻璃为增益介质,采用高速气 体或者热沉传导冷却方式,可实现1~10 Hz 重复频 率输出。由于大尺寸激光晶体不易获取以及二极管 造价高昂,目前此类重复频率激光装置的输出能量 通常为百焦耳量级。

钕玻璃是高功率激光放大器中的常用增益介质,且可获得具有较好均匀性及光学质量的大尺寸样品,如 NIF 中使用的钕玻璃尺寸已达802 mm×457 mm×41 mm^[14]。氙灯抽运技术成熟、造价便宜,是大尺寸钕玻璃的良好抽运源。氙灯的发光光谱相对二极管较宽,在抽运钕玻璃过程中产生大量废热,但通过对氙灯释放热量的合理优化及有效控制,可以实现氙灯抽运钕玻璃激光放大器重复频率运行。法国 Apollon 装置采用氙灯抽运钕玻璃以及液体冷却技术方案报道了输出能量为 400 J,重复频率为 1 shot/min 的抽运激光器^[15]。ELI-Beamlines中的 L4 激光装置为实现1.5 kJ、1 shot/min 的重复频率输出,使用了通光口径为 200 mm 的硅酸盐磷酸盐混合玻璃放大器和通光口径为 300 mm 的磷酸

盐玻璃放大器,均采用氙灯抽运以及液体冷却方 式^[16]。目前二极管抽运造价昂贵,掺镱激光晶体生 长尺寸受限,因此氙灯抽运钕玻璃以及高效热控制 技术是现阶段有希望实现千焦耳量级重复频率激光 器的技术方案之一。

中等口径重复频率激光放大器研制对发展千焦 耳量级重复频率激光系统具有重要意义,国内还鲜 有相关的研究工作报道。本课题组基于氙灯抽运、 钕玻璃以及液体冷却技术研制了一台通光直径为 Φ 130 mm 的重复频率样机(RAP),通过合理的结 构设计、冷却液选型及测试等,实现了 1.3189 倍双 程净增益、双程动态波前 PV(peak to valley)平均值 为 0.2718 波长(λ)(20 °C)和 0.3223 λ (30 °C)(10 发 次, λ =1053 nm)、1 shot/min重复频率运行。

2 结构设计

重复频率样机的设计不但需要具有高增益和 增益均匀性,以及分钟/亚分钟级重复频率运行能 力,同时要满足结构紧凑、超净、易于加工、拆装与 维护方便等要求。该样机结构设计如图1所示, 主要包含灯箱组件、片框组件、片腔组件和端镜组 件4个部分。灯箱组件非对称排布于片腔组件和端镜组 件,端镜组件非对称安装于片腔组件另外两侧,片 腔组件中采用全反射腔结构。片框组件为由上而 下插拔式安装,采用侧面抽运端面冷却方式;钕玻 璃采用叠片结构,叠片之间预留冷却通道,为了匹 配偏振及透过率要求,选择了45°放置。在满足刚 度和洁净度的前提下,整机采用铝合金轻量化 加工。



图 1 RAP 结构示意图。(a)灯箱组件;(b)片框组件;(c)片腔组件;(d)端镜组件 Fig. 1 Structural diagram of RAP. (a) Lamp module; (b) slab module; (c) cavity module; (d) side mirror module

对于液体直冷放大器,光场、流场和温度场耦合 均会对光束质量产生影响。在重复频率样机研制过 程中,采取了以下措施保证光束质量:1)采用控温精 度较高的恒温冷却水循环机,保证重复频率样机运 行期间主激光经过的冷却液温度偏差不超过 ±0.01 ℃;2)钕玻璃叠片采用无应力装夹;3)片框 冷却液采用下进上出的循环流动方式,并对进液口 结构进行优化,避免循环液体产生湍流;4)使用高面 型质量要求的窗口玻璃和钕玻璃。

3 冷却液选型以及测试

高效热控制技术有助于控制抽运放大过程中的 热量积累,决定了样机可以获得的重复频率,同时冷 却方式的选择对于光束放大波前质量具有重要影响。 常见的冷却方式有气体冷却和液体冷却,液体的折射



率通常大于气体,光通过冷却液界面产生的菲涅耳损 耗相对于气体冷却较小,可以获得更有效的抽运能 量,同时液体具有较高的比热,可以更快带走抽运及 放大过程中产生的废热,获得更高的重复频率。该 RAP需要冷却的部件分别为灯箱组件中的氙灯和片 框组件中的钕玻璃叠片,其冷却方式如图2所示:氙 灯浸泡在灯箱冷却液中,液体由下而上循环流动带走 氙灯抽运过程中产生的热量,片框组件采用端面冷却 方式,冷却液由下而上循环流动。RAP运行时,氙灯 光经过循环冷却液进入片框组件,经过片框内的循环 流动冷却液辐照至钕玻璃,进而实现激光放大。

(b)



图 2 RAP 冷却示意图。(a)灯箱组件冷却;(b)片框组件冷却

Fig. 2 Diagrams of RAP cooling. (a) Lamp module cooling; (b) slab module cooling

冷却液的性能对重复频率样机性能具有重要影响,因此对灯箱以及片框冷却液的性质进行了实验研究。

3.1 冷却液的基本性质

优良的冷却液需要满足流动性好、无毒或低毒、 比热高、高强度氙灯及 1053 nm 激光辐照下性质稳 定、与接触的材料耐溶剂性较好等。去离子水流动 性好、比热大、氙灯及 1053 nm 激光辐照下性质稳 定,是一种常用的优良冷却液,可用于实现灯箱冷 却。钕玻璃由于其本身易潮解,需另选不含水基的 冷却液。针对非水基冷却液选型,已报道的冷却液 有二硫化碳、四氯化碳^[17]、二溴乙烷、四溴乙烷^[18] 等,这些溶液毒性较大,且为有机物,氙灯辐照下分 解风险比无机溶液较大,不适合作为 RAP 钕玻璃 叠片冷却方案的首选冷却液。无机溶液重水(D₂O) 和 FC-770 相关性质如表 1 所示。

由表1可知,重水的折射率为1.35,热导率、比 热容等性能均优于FC-770,但其光学击穿阈值低于 FC-770,吸收系数较大,具有吸水性且价格昂贵,不 易获取。FC-770是一种电子氟化液,对1053 nm 激 光吸收较低且无毒,综合性能优越,因此FC-770 溶 液为钕玻璃叠片冷却液的首选,对其性质进行了实 验研究。

Parameter	FC-770	$D_2 O$	
Density /($10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	1.79	1.10	
Water solubility $/(mg \cdot L^{-1})$	0.0662		
Thermal conductivity /	0.0\/10=2 0.505		
$[\mathbf{W} \cdot (\mathbf{m} \cdot \mathbf{K})^{-1}]$	6.3×10 °	0.595	
Dynamic viscosity /	$1.416 \times 10^{-3} 1.12 \times 10^{-3}$		
$\left[kg \cdot (m \cdot s)^{-1} \right]$			
Refractive index	1.27	1.35	
Temperature coefficient	4.9×10^{-4}	$0 > 10^{-5}$	
of refractive index	-4.2×10	-8×10	
Optical breakdown	100	10	
threshold $/(GW \cdot cm^{-2})$	100	10	
Specific heat capacity /	1020	1200	
$[J \cdot (kg \cdot C)^{-1}]$	1030	4200	
Absorption coefficient	0.0×10^{-4}	0.15	
$(1064 \text{ nm}) / \text{m}^{-1}$	2.0×10	0.15	
Pressure drop-viscosity $/kPa$	2.859	2.260	
Temperature drop along channel /H	K 0.33	0.13	
Price /(dollar• L^{-1})	158.73	374	

3.2 FC-770 溶液化学稳定性测试

采用 FC-770 溶液作为片框结构冷却液,需要 对溶液辐照化学稳定性进行测试。考虑冷却液的使 用环境,冷却液的透过率和折射率对 RAP 的增益 及波前特性有较大影响。通常情况下,如果溶液的



3%,则认为其化学性质较为稳定。

将 FC-770 溶液放置于尺寸为 10 mm×10 mm 的 jgs1 石英比色皿中,分别进行溶液耐氙灯辐照以 及耐 1053 nm 激光辐照实验。图 3 为 FC-770 化学 稳定性测试的实验示意图。



图 3 FC-770 化学稳定性测试。(a)耐氙灯辐照测试;(b)耐 1053 nm 激光辐照测试

Fig. 3 Test of chemical stability of FC-770. (a) Test under flash-lamp irradiation; (b) test under 1053 nm laser irradiation

如图 3(a)所示, 氙灯的放电条件如下: 辐照通 量为 10 J/cm², 以每分钟一次的重复频率运行, 共 发射 200 次。使用分光光度计(精度为±0.5%)和 椭偏仪(精度为±0.25%)测量 FC-770 溶液经辐照 前后 1053 nm 处的透过率以及折射率, 如表 2 所 示,其中 Δ 代表变化率。

表 2 氙灯辐照 200 发次前后 FC-770 溶液透过率及折射率值 Table 2 Transmissivity and refractive index of the FC-770 before and after flash-lamp irradiation for 200 shots

Parameter	Before	After	Δ / $\%$
	irradiation	irradiation	
Transmissivity	0.92576	0.90366	2.3
(1053 nm)			
Refractive index	1.27437	1.26312	0.8
(1053 nm)			

 辐照前后溶液透过率及折射率的变化率 △ 分 别为 2.3%和 0.8%,均小于 3%,满足冷却液选型对 折射率及透过率稳定性要求。

如图 3(b)所示,1053 nm 激光辐照实验条件如下:辐照通量为 8.93 J/cm²,频率为 1 Hz,辐照时间为 19 h。采用分光光度计和椭偏仪测试辐照前后 1053 nm 波段 FC-770 溶液的透过率和折射率,结果 如表 3 所示。

表 3 1053 nm 激光辐照 19 h 前后 FC-770 溶液 透过率及折射率

Table 3 Transmissivity and refractive index of the FC-770 before and after 1053 nm laser irradiation for 19 h

Parameter	Before	After	Δ / $\%$
	irradiation	irradiation	
Transmissivity	0.92576	0.91624	1.0
(1053 nm)			
Refractive index	1.27437	1.26373	0.8
(1053 nm)			

辐照 19 h 后,溶液透过率和折射率的变化率分 别为 1.0%和 0.8%,均小于 3%,满足冷却液选型对 折射率及透过率稳定性的要求。文献[18]中激光辐 照后溶液透过率变化率(29.80%)明显大于折射率 变化率,结合已完成的测试,后续将重点关注透过率 的变化情况。

3.3 FC-770 溶液耐溶剂性实验

利用 FC-770 溶液作为片框结构冷却液,需要 对溶液与钕玻璃及片框中的零部件(密封条、铝合 金、铜、不锈钢材料、液管、螺钉)的耐溶剂性进行 测试。结合冷却液的使用环境,材料在该溶液中 浸泡较长时间(超过 20 d)后质量无明显下降(小 于 3%),且浸泡材料 FC-770 溶液的透过率无明显 变化(小于 3%),则认为溶液的耐溶剂性较好。将 钕玻璃及片框中的零部件(密封条、铝合金、铜、不 锈钢材料、液管、螺钉)分别编号为 1~7,采用精密 天平 对浸泡前后的零部件进行称重(精度为 0.0001 g),并对浸泡样品前后溶液透过率进行测 量(钕玻璃浸泡 20 d,片框零部件浸泡 37 d),浸泡



Fig. 4 Characteristics of samples 1-7 before and after immersing.(a) Change rate of mass; (b) change rate of transmissivity

前后材料质量变化率 Δm 及溶液透过率变化率 ΔT 如图 4 所示。

1~7 号样品浸泡前后质量变化率及溶液透过 率变化率均小于 3%,满足钕玻璃及片框零部件对 冷却液选型的要求。根据以上三组 FC-770 溶液性 质分析结果,认为 FC-770 溶液是一种可用于氙灯 抽运钕玻璃重复频率放大器的优良冷却液。

4 性能测试

增益特性和波前特性是重复频率放大器样机的 两个重要性能指标,经过单元部件测试后,对该样机 的增益特性和波前特性进行实验研究。

4.1 增益特性测试

RAP 采 用 双 程 放 大 方 式, 测 试 口 径 为 Φ 130 mm,测试采用 Continuum 公司的 1053 nm、 10 Hz激光器,该激光器输出线偏振光且全光斑能 量为 50 mJ,脉冲宽度为 20 ns。图 5 为 RAP 增益 特性的实验光路示意图,其中 $\lambda/2$ 为半波片,FR 为 法拉第隔离器,M1 为 45°全反镜,M2 为半透半反 镜,M3 为 0°全反镜,f₁、f₂、f₃分别代表焦距为 4977, 175,150 mm 的透镜,Det1 和 Det2 分别为参考光探 测器和信号光探测器。



图 5 小信号增益特性测量光路示意图

Fig. 5 Diagram of light path for small signal gain measurement

不同主泵延迟下该 RAP 的小信号净增益 G。 如图 6 所示。当主泵延迟为 190 μs 时,得到了最大 双程小信号净增益,为1.3189(主泵最佳延迟代表了 氙灯抽运过程中反转粒子数最大的时刻,此时钕玻 璃内部存储的能量最大,主激光通过增益介质提取 的能量最多,获得的放大能力最强)。





4.2 动态波前测试

波前质量是激光器的另一个重要指标,影响激 光系统的损伤特性、近场光斑均匀性以及远场焦斑 能量集中度,热量积累条件下维持稳定的波前是 RAP的必然前提。图7为本课题组搭建的波前测 量实验的光路示意图,其中 M1为45°全反镜,M2 为0°全反镜,f₁、f₂分别代表焦距为4977 mm 和 175 mm的透镜。将1053 nm 连续点光源放置在长 焦透镜 f₁的焦点处进行扩束,采用哈特曼传感器[测量精度为 $1/10\lambda(\lambda=1053 \text{ nm})$]测量两次经过 RAP 的双程动态波前(动态波前去除静态波前),测量口 径为 Φ 110 mm,测量过程中灯箱及片框冷却液处于循环工作状态。





Fig. 7 Diagram of RAP wavefront measurement system

由于冷却液在不同温度下具有不同的流动特性,将冷却液温度控制在 20 ℃和 30 ℃对,10 发次 重复频率运行时的双程动态波前 PV 值如图 8 所示。

由图 8 可知,10 发次实验中双程动态波前 PV 值均小于 1λ。当冷却液温度为 20 ℃时,10 发次 PV 平均值为 0.2718λ,方差为 0.0113;当冷却液温 度为 30 ℃时,10 发次 PV 平均值为 0.3223λ,方差 为 0.0059。根据测试结果可知,冷却温度越低,其 PV 平均值越小,使用较低温度的冷却液有利于散 热,但 FC-770 溶液的黏性随着温度的降低而增加, 导致其流动性变差,进而影响散热效率。虽然 PV





平均值较小,但其发次之间存在一定抖动,一方面需 要在更多发次下观察波前变化情况,另一方面需要 通过优化冷却参数提高波前质量的稳定性,并进一 步减小 PV 值。冷却液参数对波前质量具有重要影 响,冷却液参数优化原则如下:1)冷却液温度。冷却 液温度会影响液体折射率、流动状态(黏稠度)、光学 元件(隔板玻璃等)形变等,优化冷却液温度,在保证 光束质量的前提下,提升放大器重复频率。2)冷却 液流速和压力。理论上,增加流速可以提升散热速 度,冷却液的流速与冷却水循环机压力有关,流速增 大,需要的压力增大,引起的光学元件变形增大,对 密封性要求也增大,因此需在满足密封性和元器件 形变要求的前提下,优化冷却液的流速和压力。对 于该重复频率激光放大器样机,在目前的构型下优 化波前及增益是下一步工作的重点。

5 结 论

通过合理的结构设计及冷却液选型等,研制了 一台通光口径为 Φ130 mm、氙灯抽运钕玻璃液体冷 却激光放大器样机。采用该样机获得了 1.3189 倍 双程小信号净增益,且双程动态波前 PV 平均值分 别为 0.2718λ 和 0.3223λ(相应的冷却液温度分别为 20 ℃和 30 ℃),同时实现了 1 shot/min 重复频率 运行,为研制更大口径的千焦耳量级输出分钟级重 复频率激光系统提供了参考。通过有效控制抽运过 程和放大过程中的热量累积,采用氙灯抽运钕玻璃 液体冷却技术方案有望实现亚分钟级重复频率运 行,在该样机结构上优化波前和增益是下一步工作 的重点。

参考文献

[1] Spaeth M L, Manes K R, Bowers M, et al. National ignition facility laser system performance[J]. Fusion Science and Technology, 2016, 69(1): 366-394.

- [2] Manson M G. The laser megajoule facility: personnel safety system [C] // International Conference on Accelerator and Large Experimental Control Systems, October 8-13, 2017, Barcelona, Spain. Geneva: JACoW Publishing, 2018: 994-996.
- [3] Zheng Y X, Zhu J, Qian L J, et al. Investigation of "Shengguang-II" main amplifier[J]. Chinese Journal of Lasers, 1996, 23(4): 289-294.
 郑玉霞,朱俭,钱列加,等."神光-II"主放大器的 研制[J].中国激光, 1996, 23(4): 289-294.
- [4] Zheng W G, He S B, Zhang X M, et al. Development progress for the amplifier of the SG-III laser facility[J]. Proceedings of SPIE, 1999, 3492: 586-591.
- [5] Kramer K J, Latkowski J F, Abbott R P, et al. Neutron transport and nuclear burn up analysis for the laser inertial confinement fusion-fission energy (LIFE) engine[J]. Fusion Science and Technology, 2009, 56(2): 625-631.
- [6] Bayramian A, Armstrong P, Ault E, et al. The mercury project: a high average power, gas-cooled laser for inertial fusion energy development [J]. Fusion Science and Technology, 2007, 52(3): 383-387.
- [7] Banerjee S, Ertel K, Mason P, et al. DiPOLE: a multi-slab cryogenic diode pumped Yb : YAG amplifier [J]. Proceedings of SPIE, 2017, 8780: 878006.
- [8] Lucianetti A, Divoky M, Sawicka M, et al. HiLASE cryogenically-cooled diode-pumped laser prototype for inertial fusion energy [J]. Proceedings of SPIE, 2013, 8602: 860208.
- [9] Rus B, Bakule P, Kramer D, et al. ELI-beamlines: progress in development of next generation shortpulse laser systems[J]. Proceedings of SPIE, 2017, 10241: 102410J.
- [10] Huang W F, Wang J F, Lu X H, et al. Thermal wavefront distortion compensation in gas cooled Nd: glass amplifier based on edge heating [J]. Chinese Journal of Lasers, 2017, 44(1): 0101001.
 黄文发,王江峰,卢兴华,等.基于边缘加热的气冷 钕玻璃放大器热波前畸变补偿[J].中国激光, 2017, 44(1): 0101001.
- [11] Huang W F, Wang J F, Lu X H, et al. LD-pumped gas-cooled multislab Nd: glass laser amplification to joule level [J]. High Power Laser Science and Engineering, 2018, 6(2): e15.
- [12] Albach D, Arzakantsyan M, Bourdet G, et al. Current status of the LUCIA laser system [J]. Journal of Physics: Conference Series, 2010, 244

(3): 032015.

- [13] Huang T R, Huang W F, Wang J F, et al. High energy diode-pumped sapphire face-cooled Nd: glass multi-slab amplifier[J]. Optics & Laser Technology, 2018, 107: 415-423.
- [14] Hu L, Chen S B, Tang J P, et al. Large aperture N31 neodymium phosphate laser glass for use in a high power laser facility [J]. High Power Laser Science and Engineering, 2014, 2: e1.
- [15] Papadopoulos D N, Zou J P, Le Blanc C, et al. The Apollon 10 PW laser: experimental and theoretical investigation of the temporal characteristics[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2016, 4: e34.
- Gaul E, Chériaux G, Antipenkov R, et al. Hybrid OPCPA/glass 10 PW laser at 1 shot a minute[C] // Conference on Lasers and Electro-Optics: Science and Innovations 2018, May 13-18, 2018, San Jose,

California, USA. Washington, D.C.: OSA, 2018: Stu $\#\,M.2.$

- Perry M D, Banks P S, Zweiback J, et al. Laser containing a distributed gain medium: US6937629B2
 [P/OL]. 2008-08-30[2019-03-15]. https://patents.glgoo.top/patent/US6937629B2/en.
- [18] Gui L. Research on a novel fluid state laser technology [D]. Shanghai: University of Chinese Academy of Sciences, 2013: 36-44.
 桂珞.新型流体激光技术探索研究[D].上海:中国 科学院大学, 2013: 36-44.
- [19] Todd D. Toward rep-rated kJ-class femtosecond 10 PW lasers[C] // The 2nd International Symposium on High Power Laser Science and Engineering, March 15, 2016, Suzhou, Jiangsu, China. [S.l.: s.n.], 2016, oral talk.